日本で開発された光ファイバ量産製法

登録番号	第 00274 号		
登録年月日	令和元年9月10日	登録区分	第二種

名称 (型式等)	VAD法光ファイバ母材製造装置
所 在 地	東京都武蔵野市
	NTT技術史料館
所 有 者 (管理者)	日本電信電話株式会社 情報ネットワーク総合研究所
製作者(社)	早川鉄工所
製作年	1977年頃
初出年	1977年
選定理由	VAD (Vapor-phase Axial Deposition, 気相軸付) 法石英系光ファイバの 量産製法の開発に用いられた実験装置である。堆積装置、透明化装置、線 引装置、制御装置、改良された原料供給装置が残されている。得られた実 験データが1977(昭和52)年7月に東京で開催された光 IC/ファイバ国際 会議(I00C'77)でのVAD法発表のベースになった。今日では、世界の通信 用光ファイバの約60%(日本では90%以上)がこのVAD法を基本として製 造され、通信インフラストラクチャを支える技術として重要である。
登録基準	一一ハ (新たな科学技術分野の創造に寄与したもの)二一イ (国民生活の発展、新たな生活様式の創出に顕著な役割を果たしたもの)

公開·非公開

公開

写 真



その他参考と なるべき事項